

## PRESS RELEASE

### 13.5nm 極端紫外 (EUV) 用平面ミラーの短納期供給を開始

ビームステアリングや材料科学に最適

2018年11月(東京都文京区) - 米国 Edmund Optics® (EO) の日本法人、エドモンド・オブティクス・ジャパン株式会社は、[極端紫外 \(EUV\) 用平面ミラー](#)の発売を開始した。このミラーは、精密研磨された多層膜ミラーで、設計波長と入射角 (AOI) で反射率が最大となるようデザインされている。EUV 放射のビームステアリングや高調波分離用に最適。



#### 13.5nm で最大反射率

極端紫外 (EUV) 用平面ミラーは、入射角 5° と 45° をラインナップし、EUV 放射においてもっとも高い反射率の波長である 13.5nm でほぼ理想的な反射率になる。RoHS 指令に準拠し、スーパーポリッシュされた単結晶シリコン基板にコーティングが蒸着されているため、熱的安定性に優れている。また、この EUV 用ミラーは、3Å RMS 未満の面粗さをもち、入射光の散乱を大幅に低減する。多層膜の金属 / 半導体コーティングには、シリコン (Si) が上層のモリブデン (Mo) / Si 多層膜も含まれる。平面度は 632.8nm の波長で  $\lambda/10$ 、板厚は 6.35mm。入射角 45° のミラーは s 偏光のビームステアリングに最適。また、入射角 5° のミラーは非偏光との使用に適している。

#### CDI および材料科学の研究に最適

極端紫外 (EUV) 用平面ミラーは、コヒーレント回折イメージング (CDI) や材料科学といった新しいアプリケーションで使用されている。CDI は、10nm に近い分解能を達成可能な非接触の撮像技術で、非常に小さなナノ構造の分析に使われている。このミラーは、高調波発生 (HHG) ビームの高調波セレクターとしても機能。極端紫外 (EUV) 用平面ミラーは、全品在庫販売体制で、お客様に短納期で供給する。

本製品の詳細は、下記ウェブページをご覧ください：

<https://www.edmundoptics.jp/f/extreme-ultraviolet-euv-flat-mirrors/39087/>

#### About Edmund Optics, Inc.

Edmund Optics® (EO) は、光学部品、画像、フォトンクス技術のリーディングカンパニーです。R&D、エレクトロニクス、半導体、製薬、バイオメディカルなど、世界中のマーケットをサポートしています。EO の製品は、DNA 分析から網膜による個人認証、また高速 FA 用途に至るまで、幅広いアプリケーションに用いられます。EO 最新の製造ケイパビリティとグローバル物流ネットワークの融合により、光学部品を在庫販売する No.1 サプライヤーとして、市場で認知されています。日本のお客様は、現地法人のエドモンド・オブティクス・ジャパン株式会社がサービスいたします。当社の製品ラインナップは、EO の日本語版総合カタログ、或いはウェブサイト ([www.edmundoptics.jp](http://www.edmundoptics.jp)) をご覧ください。